### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局





## (43) 国際公開日 2005 年9 月29 日 (29.09.2005)

**PCT** 

# (10) 国際公開番号 WO 2005/091363 A1

(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: H01L 23/36, 23/373

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/004861

(22) 国際出願日: 2005年3月11日(11.03.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-77371 2004 年3 月18 日 (18.03.2004) JF

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会 社日立製作所 (HITACHI, LTD.) [JP/JP]; 〒100-8280 東 京都 千代田区 丸の内一丁目 6番 6号 Tokyo (JP).

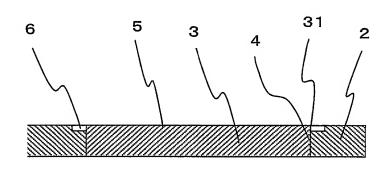
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 原田 幸治 (HARADA,Kouji) [JP/JP]; 〒312-8503 茨城県 ひたち

なか市 高場 2 5 2 0 番地 株式会社日立製作所 オートモティブシステムグループ内 Ibaraki (JP). 徳田 博厚 (TOKUDA,Hiroatsu) [JP/JP]; 〒312-8503 茨城県 ひたちなか市 高場 2 5 2 0 番地 株式会社日立製作所オートモティブシステムグループ内 Ibaraki (JP). 小島 和夫 (OJIMA,Kazuo) [JP/JP]; 〒312-8503 茨城県 ひたちなか市 高場 2 5 2 0 番地 株式会社日立製作所オートモティブシステムグループ内 Ibaraki (JP). 小林 正幸 (KOBAYASHI,Masayuki) [JP/JP]; 〒312-8503 茨城県 ひたちなか市 高場 2 5 2 0 番地 株式会社日立製作所オートモティブシステムグループ内 Ibaraki (JP).

- (74) 代理人: 作田 康夫, 外(SAKUTA,Yasuo et al.); 〒 100-8220 東京都 千代田区 丸の内一丁目 6 番 1 号 株式会社日立製作所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

/続葉有/

- (54) Title: HEAT SINK BOARD AND MANUFACTURING METHOD THEREOF
- (54) 発明の名称: ヒートシンク基板とその製造方法



(57) Abstract: A second heat sink (3) made of a material having a smaller linear expansion coefficient than that of a first heat sink (2) is bonded to the first heat sink (2) to form a heat sink board. The second heat sink (3) is fitted in a hole of the first heat sink (2), the first heat sink (2) in the vicinity of the fitting boundary part is plastically deformed for adhesion to the second heat sink (3). Such forming method makes bonding between the first and the second heat sinks possible at a room temperature, and the heat sink board composed of a composite member having a high planar accuracy can be easily and surely provided.

(57) 要約:

<sup>7</sup>O 2005/091363

第1のヒートシンク(2)に、前記第1のヒートシンク(2)よりも線膨 振係数の小さい材料からなる第2のヒートシンク(3)を結合してヒートシ ンク基板を形成するにあたり、第1のヒートシンク(2)の穴に第2のヒー トシンク(3)を嵌合し、その嵌合境界部の近傍にある第1のヒートシンク (2)を塑性変形させて、第2のヒートシンク(3)に密着させることを特 徴とする。このような形成方法により、第1及び第2のヒートシンク間の結 合は常温で可能となり、平面精度の高い複合部材からなるヒートシンク基板 を、容易かつ確実に提供することができる。



ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,

IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

### 添付公開書類:

#### 一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

PCT/JP2005/004861

# 明 細 書

1

# ヒートシンク基板とその製造方法

### 技術分野

本発明はヒートシンク基板とその製造方法に係り、特に発熱量の大き い電子部品の搭載、取り分け半導体部品を搭載する電気自動車用インバ ータ、或いはパワーモジュール等に適したヒートシンク基板とその製造 方法に関する。

### 背景技術

従来、発熱量の大きな電子部品である半導体部品を搭載するヒートシンク基板は、基本的に銅材(Cu)が用いられ、一枚板で構成するのが一般的であった。このタイプはヒートシンク基板が一枚板で済むため安価で、材質面から見ても銅材のため放熱性が良好であった。

しかしながら、銅材(Cu)は線膨張係数が16.6(ppm/C)と大きく、搭載する半導体部品からの発熱で線膨張係数の異なるはんだ接合面に熱応力による亀裂が生じるという問題があった。この亀裂の発生をなくすために銅材の代わりに線膨張係数が9.2(ppm/C)と小さく放熱性も比較的良好な銅ーモリブデン(Cu-Mo)複合材で一枚のヒートシンク基板を形成することも知られている。

この場合は、材料コストの高いモリブデン(Mo)を多量に使用した Cu-Mo複合材で一体品としているので非常に高価なものになる問題 があった。

特許文献1 (特開平8-186204号公報)には、半導体素子の熱 膨張率に近似した材料で出来た搭載部と、熱伝導及び熱放散特性に優れ

2

た材料で出来た放熱部材とを備え、搭載部材と放熱部材を加熱による溶 浸接合により一体化したヒートシンク基板を形成することが開示されて いる。

特許文献 2 (特開平 6 - 7 7 6 7 8 号公報)には、ニッケル一鉄合金で形成された母材の所定の位置に孔を設け、該孔に銅系の金属からなる放熱部材をねじ込み或いは圧入により埋め込むことにより一体化したヒートシンク基板を形成することが開示されている。

ところで、前述した複数部材からなるヒートシンク基板は効率良く熱を放出するために発熱源と密着しなくてはならない。そのため、たとえば発熱源が半導体の場合には半導体をはんだ付けして搭載するために平面度などの製品精度が要求される。

しかしながら前者の特許文献1では溶接,ろう付けのように熱を加えた結合方法で熱変形等により結合精度が低く、結合後にはんだ付け面などの必要部に機械加工が必要であるなどの問題があった。熱を使用するためのエネルギーロスや材料歩留りの点でも不利であった。

また、後者の特許文献2のようにネジ締めする方法では母材と放熱部材との締結部の密着性が低く、ヒートシンク基板のように板厚が薄いものでは有効なネジ長さを確保できないと共に、ネジ締めでは緩みが生じるなどの懸念がある。また、圧入は柔らかい材料である放熱部材に圧入による変形圧がかかるため、平面度が出し難く、場合によっては平面仕上げ加工が必要となり生産性、コストの面で不利は否めない。

本発明の目的は、製品精度が高くて、生産性に優れたヒートシンク基板とその製造方法を提供するにある。

# 発明の開示

本発明は、第1のヒートシンクにそのヒートシンクより線膨張係数の 小さい第2のヒートシンクを結合して形成してなるヒートシンク基板で あって、

3

PCT/JP2005/004861

第1のヒートシンクに第2のヒートシンクを嵌合し、その嵌合境界部 の近傍にある第1のヒートシンクを塑性変形させて第2のヒートシンク に密着させることにより達成される。

本発明の好ましくは、第2のヒートシンクは半導体部品を搭載するチップ部材により達成される。

本発明の好ましくは、第1のヒートシンクは嵌合境界部の結合面に塑性結合用押圧溝が形成され、第2のヒートシンク材を受け入れることにより達成される。

本発明の好ましくは、第1のヒートシンクはCu系材料からなり、第 2のヒートシンクはCu-Mo複合材からなることにより達成される。

本発明の好ましくは、第2のヒートシンクは塑性流動結合による凹状 圧痕により全周のエッジ部が露出していることにより達成される。

本発明の好ましくは、第2のヒートシンクは半導体部品をはんだ付け により固着していることにより達成される。

本発明の好ましくは、第1のヒートシンクの内周面と第2のヒートシンクの外周面間に熱伝導性ペーストもしくはワックスを介して両者間を 塑性流動結合したことにより達成される。

本発明の好ましくは、第1のヒートシンクの底面と第2のヒートシンクの低面間に熱伝導性ペーストもしくはワックスを介して両者間を塑性 流動結合したことにより達成される。

本発明は、第1のヒートシンクにそのヒートシンクより線膨張係数の 小さい第2のヒートシンクを結合してなるヒートシンク基板の製造方法 であって、

WO 2005/091363

第1のヒートシンクに設けられた嵌合穴に第2のヒートシンクを嵌合し、その後、前記第2のヒートシンクの外周壁にそって下降する結合パンチにより前記第2のヒートシンクと接する前記第1のヒートシンクの周囲の部材を局部的に塑性変形させ塑性流動結合させることにより達成される。

本発明は、第1のヒートシンク嵌合穴に第2のヒートシンクが嵌合され、その嵌合境界部の第1のヒートシンクが塑性変形して第2のヒートシンクに結合するヒートシンク基板としているため、両部材間の結合は常温で可能となり、平面精度の高い複合部材からなるヒートシンク基板が容易確実に提供される。

本発明は、第1のヒートシンクに第2のヒートシンクを嵌合し、その後、前記第2のヒートシンクの外周壁にそって下降する結合パンチにより前記第2のヒートシンクと接する前記第1のヒートシンクの周囲の部材を局部的に塑性変形させて塑性流動結合させることによってヒートシンク基板を得ているので、結合時に形成された第2ヒートシンク(チップ)近傍の塑性結合押圧溝(圧痕)が、半導体を搭載する時に生じるはんだのたれを特別な治具を用いることなく防止でき、生産性の高い発熱部品搭載用ヒートシンクを提供することができる。

#### 図面の簡単な説明

- 第1図は本発明の一実施形態を示すヒートシンク基板の斜視図。
- 第2図は第1図の一部縦断面図。
- 第3図は本発明に係るパワーモジュール構造の一実施形態の縦断面図。 第4図は本発明を構成する第1のヒートシンク斜視図。

第5図は本発明を構成する第2のヒートシンク斜視図。

第6図は本発明の製法に係るヒートシンク結合前の部材嵌合状態を示す縦断面図。

第7図は本発明の製法に係るヒートシンクの結合寸前の縦断面図。

第8図は本発明の製法に係るヒートシンクの加圧結合完了時の縦断面図。

第9図は本発明の第2の実施例におけるヒートシンク基板の斜視図。

第10図は本発明の第3の実施例におけるヒートシンクの加圧結合完 了時の縦断面図。

第11図は本発明の第4の実施例におけるヒートシンクの加圧結合完 了時の縦断面図。

## 発明を実施するための最良の形態

以下に本発明の具体的な実施例を説明する。尚、本発明は本実施例に限定されるものではなく、発熱部品を搭載するヒートシンク基板に広く適用される。

### 実施例1

第1図は、本発明に係るヒートシンク構造の実施例の斜視図、第2図は第1図の要部拡大縦断面図、第3図はヒートシンク上に半導体を搭載 したパワーモジュールの縦断面図である。

第1図,第2図に示すヒートシンク基板1は、銅(Cu)材からなる板状の第1のヒートシンク2とCu-Mo複合材のようなCuよりも線膨張係数が小さい材質からなる第2のヒートシンク3から構成されている。

前記第1のヒートシンク2には搭載部品に応じて複数の貫通する穴3

が設けられ、該穴3には円盤状のチップ部材である前記第2のヒートシンク3がそれぞれ嵌合され、塑性変形結合されて一体化されている。

前記第2のヒートシンク3は第2図に示すように、第1のヒートシンク2に電子部品の搭載面5が同一平面となるように嵌合され、嵌合境界部付近にある第1のヒートシンク3の部材全周を押圧して両部材間を塑性流動結合している。

第3図にヒートシンク基板1の第2のヒートシンクに半導体部品を搭載した実装状態を示している。

このヒートシンク基板1には第3図に示す様に半導体が搭載され半導体の発した熱を主にヒートシンク基板1から放熱する。第2のヒートシンク4の端面5にはCu板10がはんだ11で接合され、その上にAgろう12で窒化ケイ素板13が接合されている。さらにAgろう14を介してCu板15が接合され、更にその上にはんだ16により半導体チップ17が搭載されている。図では省略しているが実際には半導体チップ17にはアルミ線などの電気配線が施され半導体装置が構成される。

このように第2のヒートシンク3にはCu-Mo複合材のようなCu よりも線膨張係数が小さい材質のヒートシンクが用いられ、その上には んだ付けで半導体部品が接合されるため高温時の線膨張係数差によりは んだ11に亀裂が生じることがなく、高価なCu-Mo複合材の使用も わずかでよく、省資源化を実現し、極めて合理的な装置となる。

また、第2のヒートシンク3の端面5にはんだ11を流して半導体を構成するCu板10をはんだ付けするが、第1のヒートシンク2に第2のヒートシンク3を金型の押圧力で塑性変形結合する際に生じる環状の押圧痕(凹部)6が前記はんだが外周に流れ出すのを阻止する。

すなわち、前記押圧痕(凹部)6により第2のヒートシンク3の角部

3 1 が露出して見かけ上第 2 のヒートシンク 3 が第 1 のヒートシンク 2 から突出することになるので、溶融したはんだを流した時に表面張力ではんだが第 2 のヒートシンク 3 の端面 5 から流れ出ないため、容易にはんだ付けをする事が出来る。

次に上記したヒートシンク基板の製造方法について説明する。

第4図に示すような複数の貫通穴4を設けた板状のCu製第1のヒートシンク2と、第5図に示す様なCu-Mo複合材からなる円盤状の第2のヒートシンク3を第6図に示すように第1のヒートシンク2の嵌合穴4に嵌合した状態で下型7の上に載置し、セットする。Cuは軟らかく塑性変形が容易で、Cu-MoはCuよりも硬いため塑性流動結合には適した組合わせである。仮に、第1のヒートシンク2の嵌合穴4をプレス抜きして嵌合穴4が加工硬化した状態でも両者間の硬度差を確保する事が出来、実用上問題ない。

その後、第7図に示す様に環状のパンチ8で第2のヒートシンク3の外周、すなわち第1のヒートシンク2の嵌合穴4の内周近傍全周を局部的に加圧し、第8図に示す様に第1のヒートシンク2の材料を塑性流動させてヒートシンク2、3間を弾性変形圧を封入して緊迫力により密着結合する。その後パンチ8を取り除けばヒートシンク基板1は完成する。

このようにして形成されたヒートシンク基板1は、第1のヒートシンク2に第1のヒートシンク3を結合する際にわずかなパンチ力だけで第2のヒートシンク3の側面に第1のヒートシンク3の材料を塑性流動させることができるためヒートシンク基板の平行度に影響を与えることは無く、極めて製品精度の高いヒートシンク基板が得られる。

### 実施例2

また、第2のヒートシンク3は望ましくは円盤状がよいが、第9図に

示す様な矩形状でも、あるいは楕円状でもかまわない。

### 実施例3

また、第1のヒートシンク2の穴6は貫通しない袋穴であってもかまわない。

#### 実施例4

第10図は第1のヒートシンク21の貫通穴に第2のヒートシンク31を熱伝導性ペーストもしくはワックス20(一般的にはシリコンペーストが用いられる)を介して配置し、両者間を塑性流動結合したものである。一般に金属の塑性流動結合は第7図、第8図から解るようにパンチにより結合部品の周囲を局部的に押圧して集中的に押圧された部材を垂直方向に流動させているだけであるためパンチの先端から遠い部分の材料はほとんど塑性変化はない。

ところが結合された放熱部材の良し悪しは両者間が如何に緊密に密着しているかにある。そこで本実施例は第1のヒートシンク21もしくは第2のヒートシンク31のほぼ中央部にある塑性変形圧の加わらない領域に環状凹溝を設け、そこに熱伝導性ペーストもしくはワックス20を配置し両面からパンチを加えたもので、これにより第2のヒートシンク31との熱伝導機能は一段と増し、ヒートシンク基板として実用性の高いものとなる。もちろんパンチによる環状の押圧痕(凹部)61,62は両面に形成される。

なおパンチは両部材間の境界を押圧するのが一般的であるが、図示のように板厚或いは熱伝導性ペーストもしくはワックス 2 0 の配置等によって任意の位置が選ばれる。

# 実施例5

第11図は前記実施例4の問題点を踏まえて、これを袋穴の第1のヒ

ートシンク22に応用したもので、袋穴の底面もしくは第2のヒートシンク3の底面に予め熱伝導性ペーストもしくはワックス23を充填した上で、袋穴径より若干小さい径のもしくは同等径の第2のヒートシンク3を配置し、その後パンチで両部材間の境界を押圧し、パンチ直下の部材を垂直に第2のヒートシンク32の部材方向に塑性変形させて結合すると共に前記熱伝導性ペースト23を圧縮して機密性を向上させたものである。

なお、上記いずれの実施例も第1のヒートシンク2に第2のヒートシンク3を塑性流動結合してヒートシンク基板1を形成し、その後のヒートシンク基板1の状態で電子部品を搭載していく手法としているが、常温で高精度に結合できる塑性流動結合を使えば第2のヒートシンク3に電子部品を先に搭載し、その後に第1のヒートシンク2に第2のヒートシンク3を塑性流動結合しても良い。

### 産業上の利用可能性

本発明は、特に発熱量の大きい電子部品の搭載,取り分け半導体部品を搭載する電気自動車用インバータ、或いはパワーモジュール等に適したヒートシンク基板で、その利用分野は広い。

# 請 求 の 範 囲

 第1のヒートシンクにそのヒートシンクより線膨張係数の小さい第 2のヒートシンクを結合して形成してなるヒートシンク基板であって、

第1のヒートシンクに第2のヒートシンクが嵌合され、その嵌合境界 部近傍の第1のヒートシンクが塑性変形されて第2のヒートシンクに結 合されていることを特徴としたヒートシンク基板。

- 2. 請求項1記載において、第2のヒートシンクは半導体部品を搭載するチップ部材であることを特徴としたヒートシンク基板ヒートシンク。
- 3. 請求項1もしくは2記載において、第1のヒートシンクは嵌合境界部の結合面に塑性結合押圧溝が形成されていて、塑性変形された第2のヒートシンク材を受け入れていることを特徴としたヒートシンク基板。
- 4. 請求項1ないし3記載のいずれかにおいて、第1のヒートシンクは Cu系材料からなり、第2のヒートシンクはCu-Mo複合材からなる ことを特徴とした半導体装置用ヒートシンク。
- 5. 請求項1ないし4記載のいずれかにおいて、第1のヒートシンクと第2のヒートシンクの電子部品搭載面は同一平面をなし、前記第2のヒートシンクは塑性流動結合による凹状圧痕により全周のエッジ部が露出していることを特徴としたヒートシンク基板。
- 6. 請求項 5 記載において、第 2 のヒートシンクは半導体部品をはんだ付けにより固着していることを特徴とした半導体装置用ヒートシンク。
- 7. 請求項1, 2, 3のいずれかの記載において、第1のヒートシンクの内周面と第2のヒートシンクの外周面間に熱伝導性ペーストもしくはワックス20を介して両者間を塑性流動結合したことを特徴としたヒートシンク基板。
- 8. 請求項1, 2, 3のいずれかの記載において、第1のヒートシンク

1 1

の底面と第2のヒートシンクの低面間に熱伝導性ペーストもしくはワックス20を介して両者間を塑性流動結合したことを特徴としたヒートシンク基板。

9. 第1のヒートシンクにそのヒートシンクより線膨張係数の小さい第 2のヒートシンクを結合してなるヒートシンク基板の製造方法であって、 第1のヒートシンクに設けられた嵌合穴に第2のヒートシンクを嵌合 し、その後、前記第2のヒートシンクの外周壁にそって下降する結合パ ンチにより前記第2のヒートシンクと接する前記第1のヒートシンクの 周囲の部材を局部的に塑性変形させ両者間を塑性流動結合させることを

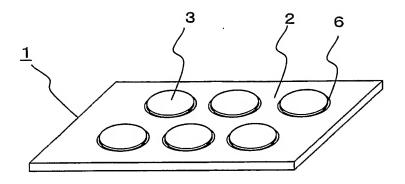
10.第1のヒートシンクにそのヒートシンクより線膨張係数の小さい 第2のヒートシンクを結合してなる半導体装置用ヒートシンクを搭載し たパワーモジュール装置であって、

特徴としたヒートシンク基板の製造方法。

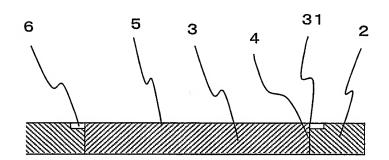
第1のヒートシンクに第2のヒートシンクが嵌合され、その嵌合境界部の第1のヒートシンクが塑性変形して第2のヒートシンクに密着している半導体装置用ヒートシンクを搭載したことを特徴としたパワーモジュール装置。

1/4

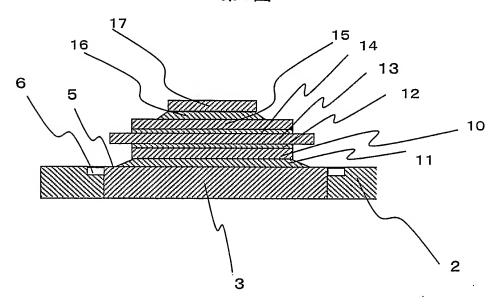
第1図



第2図

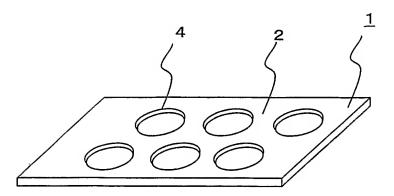


第3図

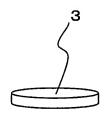


2/4

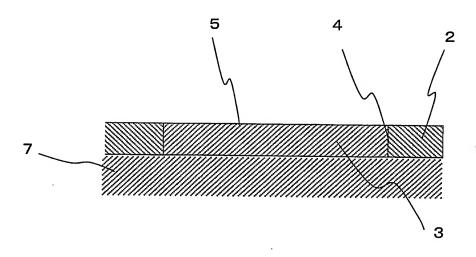
第4図



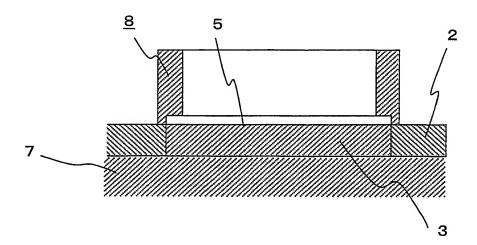
第5図



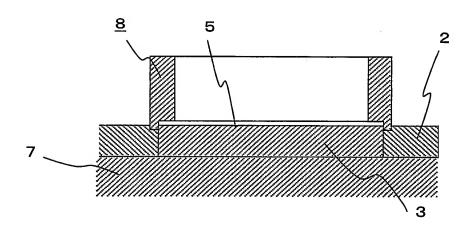
第6図



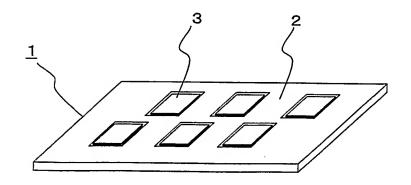
3/4 第7図



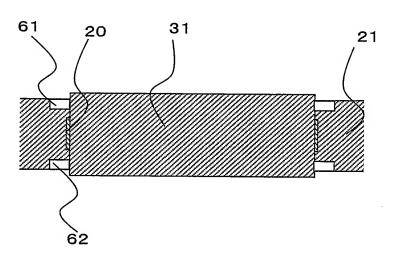
第8図



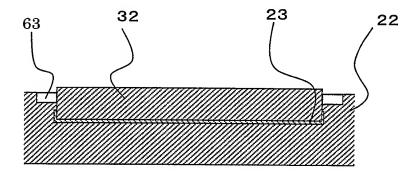
第9図



第10図



第11図



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

		PCT/J	F2005/004861		
	CATION OF SUBJECT MATTER				
Int.Cl'	H01L23/36, 23/373				
According to Inte	ernational Patent Classification (IPC) or to both nationa	l classification and IPC			
B. FIELDS SE					
Minimum docum	nentation searched (classification system followed by cla	assification symbols)			
IIIC.CI	H01L23/36, 23/373, H05K7/20,	B21D39/00			
	earched other than minimum documentation to the exter				
		tsuyo Shinan Toroku Koho			
KOKAI UI	itsuyo Shinan Koho 1971-2005 To	roku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2005		
Electronic data b	ase consulted during the international search (name of d	lata base and, where practicable, searc	ch terms used)		
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
Y	JP 11-317478 A (Suzuki Co., :	Ltd.),	1-10		
	16 November, 1999 (16.11.99),				
	Par. Nos. [0017] to [0035]; F	'igs. 1 to 16			
	(Family: none)				
Y	JP 8-186204 A (Nippon Tangst	en Co I.td )	1-10		
*	16 July, 1996 (16.07.96),	cir co., nea.,,			
	Figs. 2, 3; Par. Nos. [0004]	to [0008]			
	(Family: none)				
	-				
Y	JP 9-225562 A (Yugen Kaisha Arai), 1-10				
	02 September, 1997 (02.09.97)	,			
	Par. Nos. [0017], [0018]; Fig	j. 3			
	(Family: none)				
X Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.					
	gories of cited documents:		e international filing date or priority		
"A" document defining the general state of the art which is not considered		date and not in conflict with the ap			
to be of particular relevance  "E" earlier application or patent but published on or after the international		"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be			
filing date		considered novel or cannot be co	onsidered to involve an inventive		
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other		step when the document is taken a "Y" document of particular relevance;			
special reason (as specified)		considered to involve an invent	tive step when the document is		
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than		combined with one or more other s being obvious to a person skilled i	such documents, such combination n the art		
		"&" document member of the same pat			
	l completion of the international search	Date of mailing of the international			
27 May,	2005 (27.05.05)	14 June, 2005 (14	4.06.05)		
	g address of the ISA/	Authorized officer			
	se Patent Office				
		Talanhana Na			

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/004861

C (Continuation	). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
У	JP 2000-151163 A (Showa Aluminum Corp.), 30 May, 2000 (30.05.00), Par. Nos. [0010] to [0013]; Figs. 2 to 6 (Family: none)	1-10
A	Par. Nos. [0010] to [0013]; Figs. 2 to 6	1-10
E DOWNER 1/2	10 (continuation of second sheet) (January 2004)	1

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Α. Int.Cl.<sup>7</sup> H01L 23/36, 23/373

#### 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl.<sup>7</sup> H01L 23/36, 23/373, H05K 7/20, B21D 39/00

#### 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2005年

日本国実用新案登録公報

1996-2005年

日本国登録実用新案公報

1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

関連すると認められる文献 引用文献の カテゴリー\* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示

JP 11-317478 A (株式会社鈴木) 1999.11.16, 【0017】-【0035】, Y 1-10図 1-16 (ファミリーなし)

Y JP 8-186204 A(日本タングステン株式会社)1996.07.16、図 2、 1-10

図3、【0004】-【0008】 (ファミリーなし)

Y JP 9-225562 A (有限会社アライ) 1997.09.02, 【0017】, 【0018】. 1-10図3(ファミリーなし)

▼ C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

関連する

請求の範囲の番号

#### \* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す る文献 (理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日・ 14. 6. 2005 27. 05. 2005 9631 4 R 特許庁審査官(権限のある職員)

国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915

酒井 英夫

電話番号 03-3581-1101 内線 3471

	四次1000年11日 四次1			
C(続き).	関連すると認められる文献			
引用文献の				
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その	D関連する箇所の表示	請求の範囲の番号	
Y	JP 2000-151163 A (昭和アルミニウム株式会社【0010】-【0013】, 図 2-6 (ファミリーなし)	2) 2000.05.30,	1-10	
Α	JP 2000-77582 A (株式会社河合楽器製作所) 2000.03.14, 【0010】-【0016】,図1,図2(ファミリーなし)		1-10	
			:	